

2026年 8月 21日

クミアイ化学工業株式会社

各位

中国におけるピロキサスルホン重要中間体物質特許権 侵害訴訟の和解について

クミアイ化学工業株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：横山優、以下、「当社」）は、ピロキサスルホンの重要な中間体について当社が保有する物質特許（特許番号：ZL 201210121587.2、以下「当該特許」）に基づき中国にて提起した特許侵害訴訟に関し、新たに1件が当社の勝訴的和解により解決したことをお知らせいたします。

和解条件の詳細は以下となります。

1. 当該中国企業は、当該特許の有効期間中、直接的・間接的を問わず、当該特許を侵害しない（当該特許で保護される特許化合物を製造しないこと、同特許化合物を用いてピロキサスルホンやピロキサスルホン前駆体(CAS No. 656825-92-2)を製造しないこと、を含む）。
2. 当該中国企業は、当社の知的財産権を尊重し、当該特許の有効期間中、当社の知的財産権を意図的に侵害しない。
3. 当該中国企業は、当社に対して合意した金銭を支払う。

当社のピロキサスルホン（ブランドネーム：AXEEV®）製品は長年にわたり世界の市場において使用され、高い信頼を得ています。また、当社は、ピロキサスルホンの中間体とその製造に関わる特許を含む、特許ポートフォリオを中国に限定されずグローバルに保有しています。

当社は、知的財産権が農薬産業にとって非常に重要であると考えており、中国および世界中で知的財産権の行使に取り組んでいます。

<本件に関するお問い合わせ先>

クミアイ化学工業株式会社

お問い合わせフォーム (<https://www.kumiai-chem.co.jp/inquire/>)